

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)

【公表番号】特表2003-532665(P2003-532665A)

【公表日】平成15年11月5日(2003.11.5)

【出願番号】特願2001-581778(P2001-581778)

【国際特許分類】

A 6 1 K	8/00	(2006.01)
A 6 1 Q	17/04	(2006.01)
A 6 1 K	8/30	(2006.01)
A 6 1 K	8/49	(2006.01)
A 6 1 K	8/06	(2006.01)
C 0 7 C	45/86	(2006.01)
C 0 7 C	49/84	(2006.01)
C 0 9 K	15/30	(2006.01)

【F I】

A 6 1 K	7/42	
A 6 1 K	7/00	C
A 6 1 K	7/00	D
A 6 1 K	7/00	N
C 0 7 C	45/86	
C 0 7 C	49/84	C
C 0 9 K	15/30	

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月30日(2008.4.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】ジベンゾイルメタン誘導体の光安定性を改良するための、2,4-ビス〔〔4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ〕フェニル〕-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジンの使用。

【請求項2】ジベンゾイルメタン誘導体を含む化粧品組成物の製造における、又は製造のための、該ジベンゾイルメタン誘導体の光安定性を改良することを目的とする、2,4-ビス〔〔4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ〕フェニル〕-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジンの使用。

【請求項3】UV放射線、特に日光から保護するために局所的に用いる化粧品組成物であつて、化粧品的に許容され得る担体と、少なくとも1種類のジベンゾイルメタン誘導体と、少なくとも1種類のケイ皮酸エステルと、有効量の2,4-ビス〔〔4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ〕フェニル〕-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジンとを含む化粧品組成物。

【請求項4】ジベンゾイルメタン誘導体と、ケイ皮酸エステルと、2,4-ビス〔〔4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ〕フェニル〕-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジンとを、化粧品的に許容され得る担体に組み込む、化粧品的に許容され得る担体と、少なくとも1種類のジベンゾイルメタン誘導体と、少なくとも1種類のケイ皮酸エステルと、有効量の2,4-ビス〔〔4-(2-エチルヘキシ

ルオキシ) - 2 - ヒドロキシ)フェニル] - 6 - (4 - メトキシフェニル) - 1 , 3 , 5
- トリアジンとを含む、UV放射線から保護するために局所的に用いる化粧品組成物を製
造する方法。